

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成25年7月18日 (2013.7.18)

【公開番号】特開2012-4335(P2012-4335A)

【公開日】平成24年1月5日 (2012.1.5)

【年通号数】公開・登録公報2012-001

【出願番号】特願2010-137935(P2010-137935)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

B 2 4 B 37/24 (2012.01)

C 0 8 G 18/10 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 2 2 F

B 2 4 B 37/00 P

C 0 8 G 18/10

H 0 1 L 21/304 6 2 2 S

【手続補正書】

【提出日】平成25年6月4日 (2013.6.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

研磨面と一体型窓とを有する研磨層を含む化学機械研磨パッドであって；

一体型窓が研磨層に一体化されており；

一体型窓が硬化剤とイソシアナート末端プレポリマーポリオールとのポリウレタン反応生成物であり；

前記硬化剤が 4 , 4 ' - メチレン - ビス - o - クロロアニリン、4 , 4 ' - メチレン - ビス - (3 - クロロ - 2 , 6 - ジエチルアニリン) ；ジメチルチオトルエンジアミン；トリメチレングリコール ジ - p - アミノベンゾアート；ポリテトラメチレンオキシド ジ - p - アミノベンゾアート；ポリテトラメチレンオキシド モノ - p - アミノベンゾアート；ポリプロピレンオキシド ジ - p - アミノベンゾアート；ポリプロピレンオキシド モノ - p - アミノベンゾアート；1 , 2 - ビス (2 - アミノフェニルチオ) エタン；4 , 4 ' - メチレン - ビス - アニリン；ジエチルトルエンジアミン；5 - t e r t - ブチル - 2 , 4 - トルエンジアミン；3 - t e r t - ブチル - 2 , 6 - トルエンジアミン；5 - t e r t - アミル - 2 , 4 - トルエンジアミン；3 - t e r t - アミル - 2 , 6 - トルエンジアミン；クロロトルエンジアミンおよびこれらの混合物からなる群から選択され；

前記イソシアナート末端プレポリマーポリオールがポリオールと多官能性芳香族イソシアナートとの反応生成物であり；

前記ポリオールがポリテトラメチレンエーテルグリコール、ポリプロピレンエーテルグリコール、エステルベースのポリオール、これらのコポリマー並びにこれらの混合物からなる群から選択され；

前記多官能性芳香族イソシアナートが 2 , 4 - トルエンジイソシアナート、2 , 6 - トルエンジイソシアナート、4 , 4 ' - ジフェニルメタンジイソシアナート、ナフタレン - 1 , 5 - ジイソシアナート、トリジンジイソシアナート、バラ - フェニレンジイソシアナート、キシリレンジイソシアナートおよびこれらの混合物からなる群から選択され；

イソシアナート末端プレポリマーポリオール中に含まれる未反応 N C O 部分と反応して

一体型窓を形成する硬化性アミン部分を硬化剤が含み；

硬化剤およびイソシアナート末端プレポリマーポリオールが、アミン部分：未反応 N C O 部分の化学量論量比 1 : 1 ~ 1 : 1 . 2 5 で提供され；

一体型窓が 0 . 1 容積 % 未満の空隙率を有しており；

一体型窓が 5 ~ 2 5 % の圧縮永久歪みを示し；

研磨面が、磁性基体、光学基体および半導体基体から選択される基体を研磨するのに適合されている；

化学機械研磨パッド。